真空ナノエレクトロニクスへ進化し続ける<mark>真空管</mark>



From Vacuum Tube to Vacuum Nanoelectronics

# 中本正幸

## 1. はじめに

真空管は、気密容器内で電子、イオンが運動すること により能動・受動作用する電子デバイスである. 1883 年,エジソンによる熱電子放出現象,いわゆるエジソン 効果の発見,1897年,ブラウンによるブラウン管の発明, 同年のトムソンによる電子の比電荷測定と電子の発見, 1904年,フレミングによる二極真空管の発明,1906年, ド・フォレストによる三極真空管の発明、1920年、バ ルクハウゼンとクルツによるバルクハウゼン・クルツ振 動(BK振動)の発見とマイクロ波管の発明等。19世 紀末~20世紀における物理学・電子工学上の重要な発 明・発見により真空管は誕生した. エレクトロニクス誕 生・発展の基盤となり、半導体デバイスとともに、現代 の高度情報通信社会の形成に多大な貢献をした.しかし, 熱陰極電子源の熱拡散の影響のため、多数の電子源を集 積化・小形化することができず、コンピュータのような 多数電子回路を集積した複雑な電子デバイスをはじめ, ほとんどの電子デバイスが、1960年代から半導体デバ イスに急速に置き換えられていった.一方,真空管には、 電子速度が速い、高絶縁耐圧・大電流密度が得られる、 耐温度・耐放射線性等が高いなどの, 半導体を凌駕する 利点がある.そのため、1970年代に入り、半導体加工 技術などを用いて、熱陰極ではなく、冷陰極、主に、電 界放出陰極を用いて熱拡散を克服し、サブミクロン〜ミ クロンサイズの多数の微小な冷陰極を集積化した電界放 出陰極アレー (FEA: Field Emission Array) が誕生し た<sup>(1)</sup>.近年では、次世代平面ディスプレイとして注目さ

中本正幸 正員 静岡大学電子工学研究所 E-mail m-nakamoto@rie.shizuoka.ac.jp Masayuki NAKAMOTO, Member (Research Institute of Electronics, Shizuoka University, Hamamatsu-shi, 432-8011 Japan). 電子情報通信学会誌 Vol.93 No.1 pp.23-28 2010 年1 月 ②電子情報通信学会 2010 れるフィールドエミッションディスプレイ (FED: Field Emission Display)<sup>(2)</sup>,水銀を用いず環境汚染がな く, 平面・異形光源作製可能な一般照明用及び液晶ディ スプレイのバックライト用フィールドエミッションラン プ (FEL: Field Emission Lamp)<sup>(3)~(5)</sup>, 環境・エネル ギー問題の高まりとともに注目される真空ナノパワース イッチングデバイス<sup>(6)</sup>, 耐環境性を生かした宇宙デバイ ス<sup>⑦</sup>などの研究開発に用いられ、真空ナノエレクトロニ クスといわれる分野が創成された. 従来の熱陰極真空管 も、大電流密度・大電力の特長を生かして、核融合・放 送・通信用進行波管. 高周波加熱用マグネトロンなどと して現在も活躍している.本稿では、急速に進展する真 空ナノエレクトロニクス,特に,初期より最大の研究開 発テーマとなってきた FED を中心に、その現状と課題、 最近の研究開発状況並びに進行波管,マグネトロンなど の技術進展等について述べる.

# 真空ナノエレクトロニクスの概要と 基本原理

真空ナノエレクトロニクスでは、前述のとおり、熱陰 極の代わりに電界放出陰極アレー(FEA)に高真空中で 高電界を印加して、量子力学的なトンネル効果により電 子を引き出す。その基本構造を図1に示す。高電界を印 加し、エミッタ先端の電界強度が10°~10<sup>7</sup>V/cm程度に なると、図2に示すように表面のポテンシャル障壁層が 約10nm以下と薄くなり、エミッタ内の電子がこの障壁 層を、Fowler と Nordheim により定式化された量子力 学的トンネル効果により透過し真空中に放出される。主 に次の利点が用いられる。

(1) 格子散乱による電子の速度低下がなく,原理的 には光速まで加速可能で,26Vの加速電圧で



図1 電界放出陰極アレー(FEA)の基本構造



図2 電界電子放出のエネルギーバンド図

も光速の十分の一に達する.

- (2) 主要キャリヤが電子だけであり, デバイス設計 が容易.
- (3) 電磁気学的収束・偏向などにより,電子ビーム を容易に制御可能.
- (4) 真空は,高い絶縁耐圧性を持つとともに格子散 乱などによるエネルギー損失がなく,高効率動 作が可能.
- (5) 金属・絶縁体のみで構成することが可能なた め,耐温度・耐放射線性に優れる.

- (6) フェルミレベル近傍から真空へ放出されるため 電子のエネルギーがそろっている.
- (7) 構造・材料自由度が高く, MEMS 技術等を用いて高機能デバイス創造が期待できる.

前記(1)~(3) 並びに(6) から、超高速・電子ビー ムデバイス.また.(4)から.5階建てビルディング の高さにもなる現在の電力変換設備の大きさを約1/100 に、すなわち、直径約1m、高さ数十 cm の大きさにま で小形化を可能とする筆者提案の真空ナノパワースイッ チングデバイス<sup>(7)</sup>,更に,(5)及び(7)より,高温, 高放射線等の極限環境下でも利用可能な宇宙デバイス<sup>(8)</sup> 等への応用が研究されてきた.しかし、初期より研究開 発の中心を担ってきたデバイスは FED である.真空ナ ノエレクトロニクスの主な研究課題は、(1) 高効率・ 高信頼性 FEA に関する課題,(a)破壊,電流変動が少 なく、均一に電界電子放出する FEA 開発、(b) 大面積 で低価格の FEA 実現, (c) デバイス仕様を満たす電界 放出電流が得られる FEA, (2) 真空きょう体・スペー サに関する課題,(3)低加速電圧・高輝度蛍光体材料 の開発などに大別される.最大の課題は、(1)であり、 高効率・高信頼性安定動作の FEA 及びそれらを用いた FEDに、研究開発の大部分が集約されてきた.

## 3. フィールドエミッションディスプレイ

### 3.1 FED の構成と基本原理

FED では、電界放出電子を陽極一陰極間に印加した 電圧で加速し、陽極上の RGB 蛍光体画素を逐次発光さ せて画像を表示する.代表的な FED の構成を図 3 に示 す. CRT (Cathode Ray Tube, 陰極線管)に比べて高 精細性,高輝度性の点で優れる.FED の特長は、(1) 自発光形であり、広視野角、(2)高速応答が可能(µs オーダ)で、残像のない滑らかな動画像が得られる、(3) 耐環境性に優れる、(4)高輝度、高精細、(5)画像ひ



図3 FED の基本構成



図 4 回転蒸着法エミッタを用いた 11.3 インチ FED のパネル構造



図5 回転蒸着法エミッタを用いた 14.4 インチ FED

ずみが少ない,(6)低消費電力,(7)バックライトに よる漏れ光やプラズマ維持の予備放電による発光がない ため,純粋な黒表示が容易,(8)ピーク輝度も高く10 万対1以上の高コントラスト,(9)低輝度でも色度点 が変化せず色再現性が良好,(10)「ホールド型表示」の LCD,有機 EL 等とは異なり,FED は一瞬発光して直 ちに消えるインパルス型表示のため輪郭ぼやけがない, などが挙げられる.

## 3.2 回転蒸着法(Spindt 法) FEA を用いた FED

FEA には、大別して、縦形構造と横形構造の2 種類 ある.縦形構造の一種である回転蒸着法(Spindt 法) FEA<sup>(1)</sup>は、世界最初の FED<sup>(2)</sup>に用いられ、大部分の FED は回転蒸着法 FEA を用いている.エミッタの破 壊・電界電子放出特性の不均一性・非安定性・劣化、更 にはステッパ等の使用による高コスト、また、大面積化 が困難という課題があるが,図4に示す構造の11.3 イ ンチ,VGA,フルカラーのFEDが発表された<sup>(8)</sup>.加速 電圧を3kVに増加させ,発光効率の高い蛍光体の使用 を可能とし,輝度350cd/m<sup>2</sup>,消費電力11WのFEDを 実現した.車載モニタとして,600cd/m<sup>2</sup>,消費電力4W の3インチFEDの量産化<sup>(7)</sup>.また,図5に示す3kV加 速で400cd/m<sup>2</sup>の14.4インチFEDも発表された<sup>(9)</sup>.更に, 2008年,エミッタ基底部直径を約130nmと小さくした Spindt型FEAを用いて,240Hz高速駆動が可能で動画 像ぼけのない,400cd/m<sup>2</sup>の放送局モニタ用高画質19.2 インチFEDが発表されるまでに至った<sup>(10)</sup>.

#### 3.3 新しい FEA を用いた FED

回転蒸着法 FEA の場合には、エミッタの先鋭性・均 一性などが課題であり、20~60インチサイズのプロト タイプも発表されていない.近年では、均一性・再現性 に優れた低電圧駆動の先鋭エミッタが得られ、大面積化 も可能な転写モールド法 FEA 及び、それを発展させ、真 空プロセス不要、大面積で、ナノメートルオーダの先鋭 度が得られる金型転写モールド法が発表された(11)~(13). 真空ナノデバイスの実現に重要な、ナノメートルオーダ で任意にエミッタ先端曲率半径を変化させ、駆動電圧を 任意に制御することも可能になった(7). カーボンナノ チューブ(CNT) FEAは、化学的に安定で、低真空動 作が期待されるため、研究が激増している(14),(15).長さ が10µmを越え、直径が5~50nmと小さく、低電圧駆 動が期待される、図6に示す高解像度のキャラクタディ スプレイ用 FED<sup>(16)</sup>が開発された.また,筆者らが発表 した FEL 用高輝度緑色発光蛍光体 SrGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>:Eu<sup>(5)</sup>を,従 来のブラウン管用緑色発光蛍光体 ZnS:Cu, Al の代わり に用いた FED が発表され<sup>(17)</sup>, 600cd/m<sup>2</sup>, 7.7 lm/W の



図 6 高解像度キャラクタディスプレイ用 CNTFED ピクセル ピッチ: 1.8mm, ディスプレイエリア: 57.6mm × 460.8mm.

高効率を得た. 有望な FED の一つであるが,発光が不 均一で, CNT の破壊もあり,高効率・安定 CNTFEA 作 製法,大面積・低価格化等が,今後の CNTFED の課題 である.

横形構造では、Surface-conduction Electron-emitter Display (SED, 表面伝導エミッタ形ディスプレイ)があ る<sup>(18).(19)</sup>. 図7に示すように, 粒径5~10nmの超微粒 子酸化パラジウム薄膜に,通電溶融による裂け目(ギャッ プ:ナノメートルオーダ)を生じさせ,エミッタ及びゲー トとして用いて電子を引き出し,約10kVをアノードに 印加,450cd/m<sup>2</sup>,コントラスト10万:1,55インチフ ル HD (1,920×1,080 画素)のプロトタイプを試作し ている<sup>(19)</sup>.印刷法で形成できるため,大画面 FED 形成 に向き低コスト等,様々な利点を持っている.

自発光で広視野角,低消費電力で,高精細,小~大画 面まで作製可能,また,広い動作温度領域を持つ FED は, 次世代平面ディスプレイとして高いポテンシャルを持っ ている.解決すべき技術課題は数多くあるが,FED の 量産も開始された.高度情報化社会を担う,高品質ディ スプレイの実現が期待される.

# 4. フィールドエミッションランプ(FEL)

FELは, FEA 基板と蛍光体を塗布したアノード基板 を真空容器中に対向させ,電子を加速して蛍光体を励起 発光させる光源である.その特長は(1)水銀不使用,(2) 平面発光・前面発光が可能で,管形蛍光ランプの実効全 光束が表示全光束よりも大幅に低い(30~70%減)の に比較して実効全光束と全光束がほぼ等しい,(3)平面, 管形以外の異形光源(曲面等)が可能,(4)温度変化・ 湿度に強い,(5) X-Yマトリックス形成不要でエミッ タ欠陥の許容率が高く,低コストなどの特長を持つ.筆 者は,低環境負荷の次世代照明としてFELを1991年よ り提唱<sup>(11)</sup>,研究を開始し,水銀レス光源としては初め て既存の蛍光ランプと同等の実効発光効率約40 lm/W を持つ一般照明用プロトタイプを開発した<sup>(4)</sup>.また, 高効率発光蛍光体及び局所調光可能な水銀レス面発光光 源も開発し,初めて既存の蛍光ランプを越える液晶バッ クライト性能を達成した<sup>(5)</sup>.ここ数年,韓国,台湾を中 心にFEL研究が急激に活発化している<sup>(20)</sup>.

# 5. マグネトロン

マグネトロンは、1921年に、アルバート・ハルによっ て発明され、カソードと円筒形アノードを持ち、その管 軸方向に磁界を加えた二極管である。1927年に、岡部 金治郎はアノード円筒を分割し、第二種電子振動と呼ば れる新しい振動を見いだし、現在、広く用いられる多分 割アノード形マグネトロンを開発した。図8にマグネト ロンの基本構成とその原理を示す。中心軸にあるカソー ドから放出された電子は、磁界によりローレンツ力が働 き曲げられる。磁界を強くすると電子はアノードには到 達せずにトロコイド式軌道を描き、カソード周囲を旋転 しながら周回する。電子は分割電極片に順次電荷を誘導 し、周期とアノード分割片の数に応じた振動数のマイク ロ波を発生する。第2次世界大戦中にレーダの誕生に多 大な貢献をした。1945年に、マイクロ波により食物(ポッ プコーン、鶏卵)が加熱されることが発見され、1953





図8 マグネトロンの基本構成とその原理 中心軸のア ノードから放出された電子は強磁界印加により,ローレンツ 力により曲げられる.電子はアノードには到達せず,カソー ドの周囲を旋転しながら周回し分割電極片に電荷を誘導し分 極片の数に応じた振動数のマイクロ波を発生させる.



図9 進行波管の基本構成とその原理 真空中において電子銃 から放出された電子ビームの速度が同方向に進むらせん遅波回路 により減速された電磁波の速度とほぼ等しい場合に電子ビームと 電磁波の間に生じる相互作用を利用してマイクロ波が増幅され る.増幅出力は集電極に集められる.

年に電子レンジが実用化された.現在,ほとんどのマグ ネトロンは電子レンジ用である.出力効率向上のために は資源枯渇が懸念される希土類磁石が必要であったが, 新たな磁気回路設計により従来の磁石でも1.2 倍の磁 束,6%の出力効率向上が得られる<sup>(21)</sup>など,現在も開発 が進められている.価格完成度が高く,筆者も1990年 代前半に検討はしたが,真空ナノエレクトロニクスの応 用はほとんど試みられていない.

## 6. 進行波管

1942年に、コンフナーは進行波管(TWT: Traveling Wave Tube)を考案し、1947年に理論が確立された. 図9に、進行波管の基本構成とその原理を示す.電子銃 と高周波の移相速度を遅くするらせん遅波回路、電子 ビームを遅波回路全長にわたり集束させる電子ビーム集 束磁界、及び集電極で構成される.電子銃から放出され た電子ビームの速度が、同方向に進むらせん遅波回路に より減速された電磁波の速度とほぼ等しい場合に、電子 ビームと電磁波間に生じる相互作用を利用してマイクロ 波を増幅する.通信・放送用、特に衛星通信用、レーダ 用として用いられた.省エネルギー、立ち上げ時間の低 減、小形化が得られるため、真空ナノエレクトロニクス の応用が開始され,周波数 11.5GHz で出力 28.2W,効 率約 10%<sup>(22)</sup>や,周波数 4GHz で出力 45W,効率 25%<sup>(23)</sup> の進行波管が試作されている.

# 7. おわりに

真空管は、エレクトロニクス誕生・発展の基盤となり、 現代の高度情報通信社会を形成した.熱陰極を用いた従 来の真空管は、大部分が半導体デバイスに置き換えられ、 代表的な真空管であるブラウン管も姿を消しつつある. しかし、半導体デバイスでは困難な高出力電子デバイス では、マグネトロンや進行波管などが現在も活躍してい る.一方、MEMS技術などを利用し、集積化・小形化 の障害であった熱陰極ではなく冷陰極を用いた真空ナノ エレクトロニクスが誕生・発展しつつある.高絶縁耐 圧・大電流密度が得られる、耐温度・耐放射線性等が高 いなどの半導体デバイスを凌駕する利点を持ち、21 世 紀のグリーンエレクトロニクスの発展に多大な貢献をす ることが期待される.

#### 献

 $\mathbf{\nabla}$ 

- C. A. Spindt, I. Brodie, L. Humphrey, and E. R. Westerberg, "Physical properties of thin-film field emission cathodes with molybdenum cones," J. Appl. Phys, vol.47, no.12, pp.5248-5263, 1976.
- (2) R. Meyer, A. Ghis, P. Rambaud, and F. Muller, "Microtips fluorescent displays," Japan Display 86 Tech. Digest, pp.513-515, 1986.
- (3) M. Nakamoto, H. Kominami, Y. Nakanishi, Y. Takigawa, Y. Ohgi, H. Hiraki, and M. Haba, "White color flat field emission lamps for high quality general lighting," IDW '05 Tech. Digest, pp.1997-1998, 2005.
- (4) M. Nakamoto, K. Shiratori, G. Sato, H. Kominami, Y. Nakanishi, H. Hiraki, and M. Haba, "White color flat field emission lamps with newly developed high luminance green phosphor," IDW '07 Tech. Digest, pp.1349-1352, 2007.
- (5) H.X. Wang, H. Harazono, N. Jiang, H. Hiraki, Y. Harada, M. Haba, and M. Nakamoto, "Fabrication of high brightness flat field emission lamp with 6kV anode voltage for local dimming LCD BLU," SID '08 Tech.Digest, pp.74-77, 2008.
- (6) M. Nakamoto, T. Hasegawa, and K. Fukuda, "Uniform, stable and high integrated field emitter arrays for high performance displays and vacuum microelectronic switching devices," International Electron Devices Meeting, Tech. Digest, pp.717-720, 1997.
- (7) M. Nakamoto, J. Moon, and K. Shiratori, "Low work function nanometer-order controlled transfer mold field emitter arrays," IVMC '09 Tech. Digest, pp.29-30, 2009.
- (8) K. Sakurada, M. Kitada, T. Niiyama, M. Namikawa, Y. Takeya, and M. Tanaka, "Development of high resolution Spindt-type FED," IDW '06 Tech. Digest, pp.1805-1808, 2006.
- (9) S. Itoh, M. Tanaka, T. Tonegawa, M. Taniguchi, K. Tamura, Y. Marushima, Y. Fujimura, M. Namikawa, Y. Naito, F. Kataoka, K. Nawamaki, Y. Kubo, T. Niiyama, Y. Takeya, K. Deguchi, S. Kawata, Y. Sato, and T. Yamaura, "Development of field emission displays (FEDs)," IDW '06 Tech. Digest, pp.1821-1824, 2006.
- (10) Y. Iguchi, H. Kenmotsu, Y. Hatano, Y. Kato, S. Kanagawa, T. Ishii, S. Okanan, T. Kosugi, H. Ikeda, and K. Kokubu, "Technologies and prospects of fine pitch field emission display monitor," SID '08 Tech. Digest, pp.58-61, 2008.

あの技術は今 特別小特集 5. 真空ナノエレクトロニクスへ進化し続ける真空管

- (11) M. Nakamoto, T. Ono, and Y. Nakamura, "Fabrication of field emitter arrays by transfer mold technique," IVMC '93 Tech. Digest, Late News, no.28, pp.1-3, 1993.
- (12) M. Nakamoto, T. Hasegawa, T. Ono, T. Sakai, and N. Sakuma, "Low operation voltage field emitter arrays using low work function materials fabricated by transfer mold technique." International Electron Devices Meeting, Tech. Digest, pp.297-300 1996.
- (13) M. Nakamoto, K. Fukuda, A. Inoue, F. Takahashi, and S. Honda, "Low operation voltage high integrated field emitter arrays by transfer metal mold technique using ultra precision machining and super micro electroplating technology," International Electron Devices Meeting, Tech. Digest, pp.423-426, 2000.
- (14) S. Uemura, T. Nagasako, J. Yotani, T. Shimojo, and Y. Saito, "Carbon nanotube FED elements," SID '98 Tech. Digest, pp.1052-1055, 1998.
- (15) J. Yotani, S. Uemura, T. Nagasako, H. Kurachi, H. Yamada, T. Ezaki, and T. Maesoba, "High-luminance triode panel structure for large size CNT FED," IDW '01 Tech. Digest, pp.1209-1212 2001
- (16) S. Uemura, H. Kurachi, J. Yotani, T. Nagasako, T. Nakao, M. Ito, A. Sakurai, M. Kajiwara, K. Sato, and Y. Saito, "Improvements of color CNT-FED character-displays," SID '09 Tech. Digest, pp.46-49,2009.
- (17) E.J. Chi, C.H. Chang, J.H. Park, C.G. Lee, C.H. Lee, S.J. Yoo, Y.C. You, D.S. Zang, and D.H. Choe, "Recent improvements in brightness and color gamut of carbon nanotube field emission display," SID '06 Tech. Digest, pp.1841-1844, 2006.
- (18) T. Oguchi, E. Yamaguchi, K. Sasaki, K. Suzuki, S. Uzawa, and K. Hatanaka, "A 36-inch surface-conduction electronemitter display (SED)," SID '05 Tech. Digest, pp.1929-1931, 2005.
- (19) K. Yamamoto, I. Nomura, K. Yamazaki, S. Uzawa, and K. Hatanaka, "Fabrication and characterization of surface conduc-

tion electron emitters," SID '05 Tech. Digest, pp.1933-1935, 2005

- (20) Y.C. Kim, H.J. Kim, I.T. Han, Y.H. Kim, and J.M. Kim, "Development of carbon nanotube field emitters in the backlight for liquid crystal display," IVMC '09 Tech. Digest, pp.49-50, 2009.
- (21) 森 英男, "電子デバイス・材料," 東芝レビュー, vol.63, no.3, pp.53-54, 2008.
- (22) H. Makishima, S. Miyano, H. Imura, J. Matsuoka, H. Takemura, and A. Okamoto, "Design and performance of travelingwave tubes using field emitter array cathodes," Appl.Surf. Sci., vol.146, no.1-4, pp.230-233, 1999.
- (23) D. Whaley, R. Duggal, C. Armstrong, C. Bellow, C. Holland, and C. Spindt, "Operation of a low-voltage hightransconductance field-emitter-array TWT," IVEC '08 Tech. Digest, pp.78-79, 2008.

(平成 21 年 8 月 31 日受付 平成 21 年 9 月 30 日最終受付)



<sup>4か6と</sup> 中本 正幸(正員) 1977 横浜国大大学院工学研究科修士課程了. 同年(株)東芝に入社. 2004 東芝研究開発セン ター定年扱退職. 同年, 静岡大電子工学研究所 教授就任. 1986-1988 米国 MIT 客員教授. 工博. 三波長形蛍光ランプ用希土類蛍光体及び同ラン プ (商品名メロウルック),現在広く用いられ ている焦電形赤外線センサ並びに三次元超音波 検査装置を開発. 真空ナノテクノロジー, 核融 合炉用耐環境素子, カーボンナノチューブ, MEMS, 宇宙デバイス等の研究に従事. 1983-1989 The Electrochemical Society の日本人 初の Symposium Chairman, Society for Information Display (SID)の FED 委員会委員長, International Display Workshop (IDW) O MEMS Workshop 委員長, 日本 MIT 会理事.